特許協力条約

PCT

国際予備審查報告

RECTD **2 2 APR 2004**WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の む類記号 61997CT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/08552	国際出願日 (日.月.年) 04.07.2003 優先日 (日.月.年) 08.07.2002				
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01L21/3	1, 21/318, 21/205				
出願人(氏名又は名称) 関西ティー・エル	・オー株式会社				
1. 国際予備審査機関が作成したこの	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。				
	紙を含めて全部で 3 ページからなる。				
この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。					
3. この国際予備審査報告は、次の内	容を含む。				
I X 国際予備審査報告の基礎	趋				
Ⅱ □ 優先権	·				
Ⅲ 新規性、進歩性又は産業	業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成				
IV 開発明の単一性の欠如	·				
V X PCT35条(2)に規定 の文献及び説明 VI	の文献及び説明				
Win [] 国際出願に対する思見					
国際予備審査の請求書を受理した日 04.11.2003	国際予備審査報告を作成した日 09.04.2004				
名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 R 9539				
日本国特許庁(IPEA/J 郵便番号100-891	5 田中 永一				
東京都千代田区段が関三丁目	4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3469				

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/08552

Ι.	国際予備審查報	 限告の基礎					
1.							
[X 出願時の国際	禁出願 沓 類					
	到 明細哲 明細哲 明細哲	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求格と) :共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの		
	間求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第		出願時に提出されたもの PCT19条の規定にま 国際予備審査の請求費と	まづき補正されたもの		
	面図 回図	第 第 	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	国際予備審査の間求書	の と共に提出されたもの 付の ひ 簡と共に提出されたもの		
	明細審の配	列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたも 国際予備審査の請求哲	の と共に提出されたもの - 付の 各簡と共に提出されたもの -		
2.	上記の出願書	類の言語は、下記に示す場合	合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。	•		
	上記の書類は、下記の言語である 語である。 □ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語						
з.	この国際出題	頁は、ヌクレオチド又はアミノ	ノ酸配列を含んて	おり、次の配列表に基づ	き国際予備審査報告を行った。		
	□ この国際出願に含まれる魯面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された敬気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した魯面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 むの提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出 があった。						
	4. 補正により、下記の容類が削除された。						
5	5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						

国際予備審査報告	国際出願番号 PCT/JP03/08552		
V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 文献及び説明	こついての法第12名	条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付ける	
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	<u>1-8</u> 無	
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲		
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲		
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)			
文献1:JP 5-263255 A (日立電 文献2:EP 300447 A2 (HITACH)	『子エンジニア! I, LTD.) 1989.	リング株式会社)1993. 10. 12 01. 25	
献2より進歩性を有しない。 文献1には、ヘキサメチルジ によりSi3N4膜を形成する方	シラザンとNH	議調査報告で引用された文献1および文 1₃ガスを原料にしてプラズマCVD法 いる。 させる活性化室31と活性化された反応 に活性化するガスを供給するガス供給口 る。	
		•	
	٠		
		·	

PATENT COOPERATION TREATY

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

	PCT/JP2003/			
tion	PATENT COOPER	ATION TRE	ATY	
slate	PC	\mathbf{T}		d may see a crown of the name of the name to the
Anslation internat	TIONAL PRELIMINA	RY EXAMIN	ATION REPO	ORT
	(PCT Article 36	and Rule 70)		
Applicant's or agent's file reference 61997CT	FOR FURTHER ACT			nsmittal of Internations (Form PCT/IPEA
International application No. PCT/JP2003/008552	International filing date (04 July 2003 (04	day/month/year)	Priority date (de	
International Patent Classification (IPC) or H01L 21/31, 21/318, 21/205	national classification and I	PC	I	
Applicant KANSAI TECH	HNOLOGY LICENSIN	IG ORGANIZA	TION CO.,LT	TD.
This international preliminary examined is transmitted to the applicant. This REPORT consists of a total of	according to Article 36.			ry Examining Author
amended and are the basis f 70.16 and Section 607 of th	nied by ANNEXES, i.e., she for this report and/or sheets on the Administrative Instruction total of she	containing rectifica s under the PCT).	on, claims and/or tions made befor	drawings which have e this Authority (see
3. This report contains indications rel	lating to the following items:			
I Basis of the report	:			
Π Priority				
III Non-establishment	t of opinion with regard to no	ovelty, inventive ste	p and industrial a	applicability
IV Lack of unity of in				
v Reasoned statement citations and expla	nt under Article 35(2) with re unations supporting such state	egard to novelty, interment	ventive step or inc	dustrial applicability;
VI Certain documents	cited			
VII Certain defects in t	the international application			
VIII Certain observation	ns on the international applic	ation	·	
Date of submission of the demand	Di	ate of completion o	f this report	
04 November 2003 (04.	11.2003)	09 /	April 2004 (09	.04.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	A	uthorized officer		
Facsimile No.	_			
racsimile ivo.	1 172	elenhone Mo		

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP2003/008552

⊢	I. Basis of the report						
1.	1. With regard to the elements of the international application:*						
	\boxtimes	the international application as originally filed					
		the des	scription:				
l		pages	, as originally filed				
		pages	, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of				
	\Box	the clai					
		pages					
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19				
		pages	, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of				
	П	the dra					
		pages	•				
		pages	, as originally filed				
		pages	, filed with the letter of				
	\Box	the seame	ence listing part of the description:				
	L.J	pages					
		pages	, as originally filed				
		pages	, filed with the demand				
_			, filed with the letter of				
2.			to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which and application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language which is:				
			guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).				
			guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).				
			guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/				
3.	With	regard minary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international xamination was carried out on the basis of the sequence listing:				
	\square		ned in the international application in written form.				
	닏		gether with the international application in computer readable form.				
	닏		ed subsequently to this Authority in written form.				
	닏		ed subsequently to this Authority in computer readable form.				
		The sta	atement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.				
	Ш	The sta	atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has imished.				
4.		The am	endments have resulted in the cancellation of:				
		<u> </u>	the description, pages				
		<u></u>	the claims, Nos				
		t	the drawings, sheets/fig				
5.		This rep beyond t	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**				
		cement si s report 0.17).	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16				
		•	nt sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.				

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 03/08552

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
1.	Statement			-	
	Novelty (N)	Claims	1-8	YES	
		Claims		NO	
	Inventive step (IS)	Claims		YES	
		Claims	1-8	NO NO	
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES	
		Claims		NO	

2. Citations and explanations

Document 1: JP 5-263255 A (Hitachi Electronics Engineering Co., Ltd.), 12 October 1993

Document 2: EP 300447 A2 (Hitachi, Ltd.), 25 January 1989

The inventions set forth in claims 1 to 8 do not involve an inventive step in the light of documents 1 and 2 cited in the international search report.

Document 1 sets forth a method of forming a $\rm Si_3N_4$ film by plasma CVD, using hexamethyl disilazane and NH $_3$ gas as raw materials.

Document 2 sets forth a plasma processing device provided with blow-out holes (35) which feed difficult-to-activate gas into an activation chamber (31), where said gas is activated, and activated reagent gas into the reaction chamber, and a gas supply port which supplies an easily activated gas.